

平成30年3月15日

会員各位

公益社団法人 応用物理学会
次世代リソグラフィ技術研究会
幹事長 石原 直

第2回定例会開催通知

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

さて、第2回次世代リソグラフィ技術研究会の定例会のご案内が出来ましたので、ご案内させていただきます。

つきましては、ご多忙の中恐縮でございますが万障お繰り合わせの上、ご出席下さいますようお願い申し上げます。また、出来るだけ多くの方に参加していただきたいので法人会員の方は社内での回覧も併せてお願いいたします。 敬具

記

1. 開催日時：平成30年3月29日（木） 定例会：13:00 – 17:00（受付 12:40～）

2. 開催場所：ハロー会議室 秋葉原駅前 RoomB

〒101-0024 東京都千代田区神田和泉町 1-1-16 KONKO ビル 7階

交通：JR 中央・総武線 秋葉原駅 昭和通り口 徒歩 2 分

JR 山手線 秋葉原駅 昭和通り口 徒歩 2 分

東京メトロ日比谷線 秋葉原駅 1 番出口 徒歩 1 分

つくばエクスプレス 秋葉原駅 中央改札 徒歩 4 分

3. 参加費： 分科会会員（個人・法人）：無料、応用物理学会会員：2,000 円

※研究会は、本分科会会員および応用物理学会会員以外には公開しておりません。

4. プログラム： SPIE Advanced Lithography 2018 特集

13:00～13:30	『 SPIE Advanced Lithography 2018 全体報告 』 EIDEC 田中 聡氏
13:30～14:00	『 Extreme Ultraviolet (EUV) Lithography 』 ギガフォトン 鈴木 章義氏
14:00～14:30	『 Novel Patterning Technologies 』 キヤノン 木村 淳氏
14:30～15:00	『 Metrology, Inspection, and Process Control for Microlithography 』 日立製作所 津野 夏規氏
15:00～15:20	休 憩
15:20～15:50	『 Advances in Patterning Materials and Processes 』 富士フイルム 藤森 亨氏
15:50～16:20	『 Optical Microlithography 』 ニコン 大和 壮一氏
16:20～16:50	『 Advanced Etch Technology for Nanopatterning 』 日立製作所 篠田 和典氏

以上

追記:ご出欠については同封のご出欠連絡用紙にて、**FAX** もしくは **E-mail** にて開催日の3日前迄にご連絡をお願い致します。当部会は、ご講演者の都合により講演資料（配布物）はお出しできない場合があります。

会場の都合上、1社あたりの参加人数を制限させていただく場合がございます。ご了承ください。
また、ご不明な点がございましたら下記担当者までお問い合わせ下さるようお願い致します。

事務局：公益社団法人 応用物理学会
次世代リソグラフィ技術研究会担当／相良（サガラ） 好美
〒335-0021 埼玉県戸田市新曽 45
TEL(携帯)：090-5403-1147 FAX：048-443-4204
E-mail:ZXF10453@nifty.com